

сунке приведена типичная  $C-V$ -зависимость. Заметим, что характер зависимости на падающем участке (крутое падение перед минимумом) соответствует результатам работ [1, 2].

Таким образом, установлено существование растущего участка вольтъемостной зависимости обратно смещенного барьера Шоттки на тонкопленочной полупроводниковой структуре и показано, что появление этого участка обусловлено наличием перехода пленка—подложка.

### Л и т е р а т у р а

- [1] Lebovec K. // Appl. Phys. Lett. 1975. V. 26. N 3. P. 82—84.
- [2] Chen T. H., Shur M. S. // IEEE Trans. Electron. Dev. 1985. V. ED-12. N 5. P. 883—891.
- [3] Зи С. М. Физика полупроводниковых приборов. М., 1973. 655 с.
- [4] Rhoderick E. H. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1972. V. 5. N 10. P. 1920—1929.
- [5] Берман Л. С. Емкостные методы исследования полупроводников. Л., 1972. 104 с.

Институт технической механики  
АН УССР  
Днепропетровск

Получено 21.04.1988  
Принято к печати 6.09.1988

*ФТП, том 23, вып. 2, 1989*

## ЭКСИТОННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ФОСФОРОМ И ГАЛЛИЕМ В КОНЦЕНТРАЦИЯХ $5 \cdot 10^{16} \div 3 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$

Горбунов М. В., Каминский А. С.

В [1] нами были исследованы спектры рекомбинационного излучения (РИ) экситонов, связанных на «изолированных» центрах и парах «изолированных» примесных атомов фосфора и мышьяка в кремнии. В спектрах РИ были выявлены характерные полосы излучения —  $P_1$ ,  $P'_1$ ,  $P''_1$ ,  $P_2$  (ранее полоса  $P_2$  наблюдалась в спектре РИ  $\text{Si}\langle\text{B}\rangle$  [2], а полоса  $P''_1$  — в  $\text{Ge}\langle\text{As}\rangle$  [3]). Полосы  $P_1$  и  $P'_1$  объясняны излучательным распадом экситонов, а  $P_2$  — биэкситонов, связанных на парах примесных атомов. Полосам  $P_1$  и  $P'_1$  отвечают различные конечные состояния  $D_2$ :<sup>1</sup> полосе  $P_1$  — основное, а полосе  $P'_1$  — возбужденное, в котором один из доноров, входящих в  $D_2$ , находится в возбужденном состоянии  $\Gamma_3$ . Что касается полосы  $P'_1$ , то нам не удалось в [1] однозначно определить связанный с ней излучательный канал рекомбинации.

В настоящей работе рассматриваются спектры РИ экситонов, связанных на примесных атомах галлия и фосфора в кремнии. При этом особое внимание уделяется происхождению полосы  $P_1$ .

В рассматриваемом интервале концентраций примесей  $N_{D(A)}$  можно пользоваться упрощенной моделью экситон-примесной зоны (ЭПЗ) [4], считая, что от  $N_{D(A)}$  не зависит набор экситонных состояний, присутствующих в ЭПЗ, а зависит только функция плотности экситонных состояний  $\rho(N_{D(A)})$ . При этом подавляющее число состояний в ЭПЗ будет приходиться на экситоны, связанные на  $D$  и  $D_2$ , а пространственное движение экситонов в ЭПЗ будет происходить в основном при участии фононов, т. е. сопровождаться либо испусканием, либо поглощением фононов.

В [5] были рассчитаны энергия основного состояния экситона, связанного на  $A_2$  в кремнии, как функция расстояния между акцепторами  $R_A$  и плотность состояний  $\rho$  как функция  $N_A$ . Неожиданным оказалось то, что в отличие от мо-

<sup>1</sup> Далее мы будем обозначать  $k$  нейтральных доноров (акцепторов) —  $D_k$  ( $A_k$ ), а  $\rho$  экситонов, связанных на  $k$  нейтральных донорах (акцепторах), —  $\vartheta_p D_k$  ( $\vartheta_p A_k$ ).

лекулярных систем при сближении акцепторов величина сдвига уровней связывающего и антисвязывающего состояний  $\Delta E_2$  заметно больше, чем величина их расщепления. Вследствие этого функция  $\rho(N_A)$  имеет четко выраженный максимум, который по мере увеличения  $N_A$  сдвигается в область меньших энергий. При этом  $\rho(N_A)$  монотонно возрастает до  $\rho_{\max}(N_A)$ , а затем убывает. Эти результаты полезны при анализе спектрального распределения РИ в рассматриваемом нами интервале  $N_{D(A)}$ .

Для того чтобы подробно проследить за эволюцией спектра при изменении  $N_{D(A)}$ , нами исследовались образцы (размером  $100 \times 4 \times 2$  мм), в которых концентрация примесей плавно изменялась от  $5 \cdot 10^{16}$  до  $3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . Методика эксперимента описана в [1].

Рассмотрим полученные результаты. С увеличением  $N_p$  от  $10^{14}$  до  $2 \cdot 10^{16}$  и  $N_{Ga}$  от  $10^{14}$  до  $4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  полосы РИ  $\alpha_1$  и  $\alpha$  практически не уширяются (ширина на полувысоте полосы  $\alpha_1$  равна  $\sim 15$ , а  $\alpha - \sim 50$  мкэВ) [6, 1]. При этом интенсивность этих неуширенных полос быстро падает при приближении  $N_p$  и

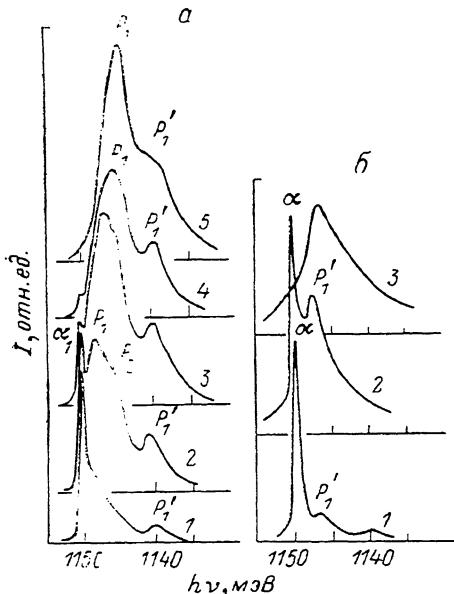


Рис. 1. Бесфоновые компоненты спектров РИ экситонов, связанных на примесных атомах фосфора и галлия в кремни, при 4.2 К.

**a** — Si<P>;  $N_p \cdot 10^{-16}, \text{ см}^{-3}$ : 1 — 6, 2 — 10, 3 — 15, 4 — 20, 5 — 25; **b** — Si<Ga>;  $N_{Ga} \cdot 10^{-17}, \text{ см}^{-3}$ : 1 — 1, 2 — 2.0, 3 — 3.0.

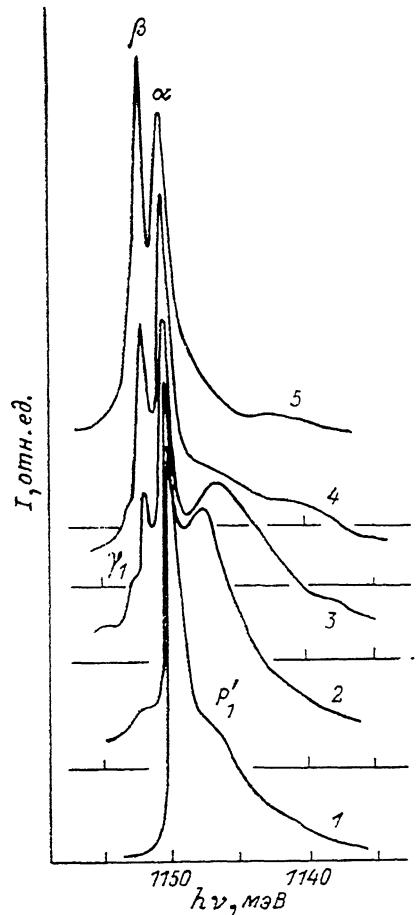


Рис. 2. Спектры РИ экситонов, связанных на атомах галлия ( $N_{Ga} = 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ), полученные при различных температурах.

$T, \text{ К}: 1 - 2, 2 - 4.2, 3 - 9, 4 - 14, 5 - 20$ .

$N_{Ga}$  к указанным верхним значениям. В интервале концентраций, рассматриваемом в настоящей работе, полосы РИ  $\alpha$  и  $\alpha_1$  значительно шире, чем в области меньших концентраций и, вероятно, включают в себя излучение как ЭД, так и ЭД<sub>2</sub>. Поскольку эти два канала рекомбинации в данном случае трудно разделять, мы оставим для этих полос старые обозначения.

На рис. 1 показана эволюция спектров РИ, полученных при малых уровнях возбуждения образцов (т. е. когда концентрация связанных экситонов  $n \ll N_{D(A)}$ ) при увеличении  $N_p$  и  $N_{Ga}$ . На рис. 2 приведены спектры РИ кремния, легированного галлием, полученные при различных температурах. Из рис. 1, **a** видно, что по мере увеличения  $N_p$  число экситонов, связанных на «изолированных» центрах и парах с большими  $R$ , убывает (интенсивность полосы  $\alpha_1$  падает). Одно-

время полоса  $P_1$ , представляющая в спектре РИ экситоны, связанные на парах с меньшими  $R$ , сдвигается в сторону меньших энергий и становится доминирующей в спектре РИ, а на длинноволновом краю спектра возгорается полоса  $P'_1$ . Причем спектральное положение полосы  $P'_1$  в рассматриваемом интервале концентраций практически не изменяется. При  $N_p \sim 4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  полоса  $P_1$  сливаются с полосой  $P'_1$  [1]. В случае кремния, легированного галлием, изменения, происходящие в спектре при увеличении  $N_{\text{Ga}}$ , те же, хотя и менее выражены (рис. 1, б).

То, что в спектре излучения экситонов, связанных на  $D$  и  $D_2$ , имеется три максимума (полосы  $\alpha_1$ ,  $P_1$ ,  $P'_1$ ), нельзя объяснить, считая, что спектральное распределение РИ определяется только функцией плотности состояний  $\rho$  (которая, как отмечалось выше, имеет один максимум). Этот факт связан, как показано в [1], с диссипативными перескоками экситонов в ЭПЗ. При этом, поскольку число пар с большими  $R$  всегда больше, чем с малыми, первые по отношению ко вторым играют роль антенн.

Появление в спектре РИ полосы  $P_1$  можно объяснить, если предположить, что экситоны из основного состояния  $\mathcal{ED}$  и  $\mathcal{ED}_2$  «перескакивают» в основное состояние  $\mathcal{ED}_2$  с меньшими  $R$  (с меньшей энергией) [1]. Для объяснения появления полосы  $P'_1$  на длинноволновом краю спектра РИ таких процессов явно недостаточно. Полоса  $P'_1$ , по нашему мнению, связана с наличием у  $\mathcal{ED}_2$  с малыми  $R$  возбужденных состояний с энергиями, попадающими в область энергий основных состояний  $\mathcal{ED}_2$  с большими  $R$ . В результате перескоков экситонов в такие возбужденные состояния  $\mathcal{ED}_2$  с малыми  $R$  и последующей их термализацией в основное состояние число  $\mathcal{ED}_2$  в основном состоянии с малым  $R$  будет увеличиваться, что вызовет в спектре РИ появление полосы  $P'_1$ . Это предположение подтверждается тем, что величины смещения этих полос по отношению к полосам  $P_1$  как в случае  $\text{Si}\langle P \rangle$  (рис. 1, а), так и в случае  $\text{Si}\langle \text{Ga} \rangle$  (рис. 1, б) близки к энергиям возбуждения экситонов, связанных на примесных атомах Р и Ga соответственно. В случае же  $\text{Si}\langle B \rangle$  полоса  $P_1$  отсутствует [2], что коррелирует с отсутствием у экситона, связанного на атомах бора, возбужденного состояния. Сделанное предположение о происхождении полосы  $P'_1$  согласуется также с приведенными на рис. 2 спектрами РИ экситонов, связанных на атомах галлия, полученными при различных температурах. Как видно из этого рисунка, при повышении температуры полоса  $P'_1$  исчезает и спектральное распределение РИ становится похожим на распределение плотности экситонных состояний в ЭПЗ. Это естественно, так как вклад экситонов с малыми  $R$  в РИ при высоких температурах мал. Линии  $\beta$  и  $\gamma$ , возгорающиеся при повышении температуры на коротковолновом краю спектра (рис. 2), связаны с возбужденными состояниями экситонов, связанных на атомах галлия [6].

Мы благодарны В. И. Роговому и Б. Н. Лейферову за содействие при выполнении работы.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Горбунов М. В., Каминский А. С. // ЖЭТФ. 1986. Т. 91. В. 3. С. 1093—1104.
- [2] Oktyabrsky S. N., Zhurkin B. G. // Sol. St. Commun. 1985. V. 54. P. 875—878.
- [3] Горбунов М. В., Каминский А. С. // ЖЭТФ. 1985. Т. 88. В. 3. С. 852—865.
- [4] Лифшиц И. М. // УФН. 1964. Т. 83. С. 617—663.
- [5] Rao D. S., Smith D. L., McGill T. C. // Phys. Rev. B. 1980. V. 21. P. 3581—3588.
- [6] Горбунов М. В., Каминский А. С., Сафонов А. Н. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. В. 2. С. 247—257.

Институт радиотехники и электроники  
АН СССР  
Москва

Получено 10.05.1988  
Принято к печати 6.09.1988